

2020年度ナノプロセッシング施設(NPF)単価表

2020年6月1日

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	備考(注1)	成果公開(注2)		
					機器利用	技術補助	技術代行(注3)
					(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF001	電子ビーム描画装置(CRESTEC)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置	有償トレーニング	5,000	12,000	13,600
NPF003	イオンコーター	CR1 クリーンルーム	表面処理装置		500	7,500	8,000
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800_FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察装置	有償トレーニング	6,000	13,000	15,600
NPF005	低真空走査電子顕微鏡	CR1 クリーンルーム	観察装置	有償トレーニング	4,000	11,000	13,600
NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置	有償トレーニング	8,000	15,000	16,600
NPF008	スピニングコーター	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置		500	7,500	8,000
NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF010	反転露光用全面UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー装置		500	7,500	8,000
NPF011	線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィー装置	技術代行専用	15,000	22,000	24,600
NPF012	ドラフトチャンバー(右)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置		500	7,500	8,000
NPF013	ドラフトチャンバー(左)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置		500	7,500	8,000
NPF014	有機ドラフトチャンバー	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置		500	7,500	8,000
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置		500	7,500	10,100
NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-I]	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置		500	7,500	8,000
NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置		500	7,500	8,000
NPF018	反応性イオンエッチング装置(RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600
NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	有償トレーニング	8,000	15,000	16,600
NPF021	プラズマアッシャー	CR1 クリーンルーム	表面処理装置		500	7,500	8,000
NPF022	UVオゾンクリーナー	CR1 クリーンルーム	表面処理装置		500	7,500	8,000
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	6,000	13,000	14,600
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600
NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600
NPF026	RF・DCスパッタ成膜装置(ULVAC)	CR1 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	4,000	11,000	13,600
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	2,000	9,000	11,600
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	3,500	10,500	12,100
NPF031	原子層堆積装置[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜装置	技術代行専用	6,000	13,000	14,600
NPF032	クロスセクションポリリッシャー(ALD付帯)	CR5 クリーンルーム	ミリング装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600
NPF033	アルゴンミリング装置	CR5 クリーンルーム	ミリング装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	2F 一般実験室	イオンビーム加工装置	技術代行専用	10,000	17,000	19,600
NPF035	イオンコーター(FIB付帯)	2F 一般実験室	表面処理装置		500	7,500	8,000
NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2F 一般実験室	イオンビーム分析装置	技術代行専用	7,000	14,000	15,600
NPF039	オゾンクリーナー(SIMS付帯)	2F 一般実験室	表面処理装置		500	7,500	8,000
NPF040	多目的高速加熱ランプ炉(RTA)	CR1 クリーンルーム	熱処理装置	有償トレーニング	2,500	9,500	11,100
NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理装置	有償トレーニング	1,500	8,500	9,000
NPF042	クリーンオープン右	CR2 イエロールーム	熱処理装置		500	7,500	8,000
NPF043	クリーンオープン左	CR2 イエロールーム	熱処理装置		500	7,500	8,000
NPF044	マッフル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理装置		500	7,500	8,000
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	測定装置		500	7,500	8,000
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM1[NanoscopeIV/Dimension3100]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置	有償トレーニング	3,000	10,000	12,600
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM2[SPM-9600/9700]	2F 一般実験室	プローブ装置	有償トレーニング	3,000	10,000	12,600
NPF048	ナノサータ顕微鏡SPM3[SFT-3500]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置	有償トレーニング	4,000	11,000	13,600
NPF049	ナノプローバ[N-6000SS]	2F 一般実験室	プローブ装置	技術代行専用	8,000	15,000	17,600
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR5 クリーンルーム	測定装置		500	7,500	8,000
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	測定装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	測定装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF053	ワイヤーボンダー	CR1 クリーンルーム	加工装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	加工装置	有償トレーニング	3,500	10,500	13,100
NPF055	スクライバー	CR4 クリーンルーム	加工装置		500	7,500	8,000
NPF056	研磨機	CR4 クリーンルーム	加工装置	有償トレーニング	1,000	8,000	9,600
NPF057	ラッピングマシン(CMP)	CR4 クリーンルーム	加工装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF058	ウェハー圧着機	CR1 クリーンルーム	加工装置		500	7,500	8,000
NPF059	レーザー顕微鏡[VK-8510](2F)	2F 一般実験室	観察装置		500	7,500	8,000
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察装置	有償トレーニング	2,000	9,000	9,500
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察装置	有償トレーニング	2,000	9,000	9,500
NPF062	全焦点顕微鏡	2F 一般実験室	観察装置		500	7,500	8,000
NPF063	分光エリブソメータ	CR1 クリーンルーム	分光評価装置	有償トレーニング	2,000	9,000	9,500
NPF064	解析用PC(分光エリブソメータ用)	2F データ解析室	その他		500	7,500	10,100
NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)	CR1 クリーンルーム	分光評価装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600
NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)	CR1 クリーンルーム	分光評価装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF067	解析用PC(CADおよびSPM, FT-IR, Raman用)	2F データ解析室	その他		500	7,500	10,100
NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	測定装置	有償トレーニング	2,500	9,500	11,100
NPF070	X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	エックス線分析装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600

2020年度ナノプロセッシング施設(NPF)単価表

2020年6月1日

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	備考(注1)	成果公開(注2)		
					機器利用	技術補助	技術代行(注3)
					(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF071	薄膜エックス線回折装置	2F 一般実験室	エックス線分析装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600
NPF072	微小部蛍光X線分析装置	CR1 クリーンルーム	エックス線分析装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF073	解析用PC(CADおよびX線用)	2F データ解析室	その他		500	7,500	10,100
NPF074	エックス線光電子分光分析(XPS)装置	2F 一般実験室	エックス線分析装置	有償トレーニング	4,000	11,000	12,600
NPF075	解析用PC(XPS用)	2F データ解析室	その他		500	7,500	10,100
NPF076	解析用PC(一般解析用)1	2F データ解析室	その他		500	7,500	10,100
NPF077	解析用PC(一般解析用)2	2F データ解析室	その他		500	7,500	10,100
NPF078	解析用PC(一般解析用)3	2F データ解析室	その他		500	7,500	10,100
NPF079	解析用PC(一般解析用)4	2F データ解析室	その他		500	7,500	10,100
NPF080	ヘリウムイオン顕微鏡	SCR産学官連携研究棟	観察装置	技術代行専用	-	-	16,000
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置(SiN)	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	4,000	11,000	12,600
NPF082	化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	技術代行専用	9,000	16,000	17,600
NPF084	デジタルマイクロスコープ	CR1 クリーンルーム	観察装置		500	7,500	8,000
NPF085	物理特性測定装置(PPMS)	2F 一般実験室	測定装置	有償トレーニング	5,000	12,000	13,600
NPF086	マニュアルウエハプロベラー(2F)	2F 一般実験室	測定装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF087	ワイヤーボンダー(2F)	2F 一般実験室	加工装置	有償トレーニング	1,000	8,000	9,600
NPF088	電界放出形走査電子顕微鏡[S4500/FE-SEM](2F)	2F 一般実験室	観察装置	有償トレーニング	3,000	10,000	12,600
NPF089	赤外線ランプ拡散炉(RTA)	CR1 クリーンルーム	熱処理装置	有償トレーニング	2,500	9,500	11,100
NPF090	レーザー加工装置	CR4 クリーンルーム	加工装置	有償トレーニング	1,000	8,000	9,600
NPF091	自動塗布現像装置	CR2 クリーンルーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	CR2 クリーンルーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	6,000	13,000	14,600
NPF093	高速電子ビーム描画装置(エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	25,000	32,000	33,600
NPF094	解析用PC(CAD及び近接効果修正用)	2F データ解析室	その他	有償トレーニング	2,000	9,000	11,600
NPF095	RF-DCスパッタ堆積装置(芝浦)	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600
NPF096	単波長エリブソメータ	CR1 クリーンルーム	測定装置		500	7,500	8,000
NPF097	両面アライナー	CR2 クリーンルーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600
NPF098	EGRスパッタ成膜・ミリング装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600
	有償トレーニング		その他				1,000 (1回)

装置番号: NPFで装置管理のために使用している番号

設置場所: 装置が設置してある部屋

装置分類: 装置の利用目的や原理に応じて分類された区分

(注1)「有償トレーニング」と記載された装置につきましては、最初のご利用の前に有償のトレーニングを受講して頂いております。
「技術代行専用」と記載された装置につきましては、原則技術代行のみでのご利用となります。

(注2) 成果非公開の単価表についてはNPF事務局(tia-npf-ml@aist.go.jp)まで別途お問い合わせください。

(注3) NPFのスタッフが他の施設(産総研の他の共用施設及びNIMS、筑波大学等他機関の共用施設)の装置の技術代行を行う場合は、装置の機器利用料に加え、一律9,600円(成果公開)を加算致します。

(注4) ヘリウムイオン顕微鏡を非公開でご利用になりたい方はスーパークリーンルーム施設よりお申し込みください。

※この単価表に記載した金額に消費税等は含まれておりません。

※消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てて処理致します。

※2020年度のご利用につきましては、ユーザーのご所属により、課金額に下記の係数が掛かります。その他、支援形態や成果公開の可否によって課金額が変わることがございます。

詳しくはNPF事務局(tia-npf-ml@aist.go.jp)にお問い合わせください。

中小企業(中小企業支援法第2条参照) 0.5

大学及び公的研究機関 0.5(産総研所属の利用者はここに該当します。)

上記に該当しない場合は 1

※その他に、来所して装置をご利用いただく場合は、ユーザーのご所属により、連携研究等経費算定要領別表第3に定める人頭経費を徴収させていただきます。(https://unit.aist.go.jp/cpiad/ci/procedure/seq/jutaku-keihi.pdf)

詳細は、NPF事務局にお問い合わせ下さい。